



即时发表

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)

Open Sky Communications

电话: +1-415-519-3915

电邮: dmoreno@openskypr.com

MICRON (美光科技) 加盟 THE EBEAM INITIATIVE

美国，加州，圣荷西，二零二零年二月二十五日—The eBeam Initiative，一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体，今天宣布，Micron 正式加入 eBeam Initiative。作为世界领先的半导体记忆和存储器件制造商，Micron 将为 eBeam Initiative 在半导体光罩和光刻供应链教育活动带来宝贵的观点。

2009 年，the eBeam Initiative 正式成立，旨在半导体设计和制造业界为电子束技术教育平台呼吁助力。The eBeam Initiative 利用年度会员意见调查和光罩制造商调查确定重要趋势来帮助引导业界前行，以支持新电子束技术的引进。Micron 在 2019 年已经加入光罩制造商调查，现在成为 50 多家公司组织成员之一，the eBeam Initiative 会持续它的创立宗旨来加强业界的联盟，促进电子束技术整体生态发展。

今天，在圣荷西会议中心举办的 SPIE 先进光刻技术会议 (Advanced Lithography Conference) 期间，the eBeam Initiative 将与电子制造深度学习中心 (CDLe) 共同赞助下，主办第十二届年度成员会议。Micron 光罩技术部资深部长韦罗素博士 (Dr. Ezequiel Vidal-Russell) 博士将在会上做主题讲演，涉及未来光罩和微影技术成功的重要课题，包括反向光刻技术 (ILT) 和曲线光罩在先进记忆器件设计上的应用。讲演稿将在二月二十五后上传到 the eBeam Initiative website at www.ebeam.org.

“电子束技术在半导体工业的发展中起着重要的作用，特别是在光罩制造和微影技术面临各种全新的挑战的今天。The eBeam Initiative 会员的支持对唤起业界对新电子技术的研发以保证半导体工业的持续发展有决定性的价值，对此我们衷心的感谢他们的努力，” D2S 执行长藤村 (Aki Fujimura) 先生表示，D2S 是 eBeam Initiative 的主办管理公司。“Micron 已经为我们年度光罩制造商调查提供了重要贡献，我非常高兴能宣布他们成为我们最新的成员。他们的专业技能和独特见识，会成为 the eBeam Initiative 重要的一员。”

关于 *The eBeam Initiative* (电子束倡议团)

The eBeam Initiative 是一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体；为有关电子束技术的教育和促进活动提供相应的论坛。The eBeam Initiative 的目标是增加电子束技术应用在半导体制造各领域中的投资；降低电子束技术应用的障碍，能够使更多集成电路设计完成，并且更快投进市场成为可能。

会员公司, 涵盖整个半导体生态系统, 包括: aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; ASML; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; eSilicon Corporation; Fraunhofer CNT; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GLOBALFOUNDRIES; Grenon Consulting; Hitachi High-Technologies; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KIOXIA; KLA; Maglen; Mentor, a Siemens Business; Micron Technology; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photonics; Sage Design Automation; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); STMicroelectronics; Synopsys; tau-Metrix; Tela Innovations; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Toppan Printing; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS. The eBeam Initiative 欢迎所有电子工业的公司和协会加盟。细节请查看 www.ebeam.org.

###